

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年8月8日(08.08.2024)



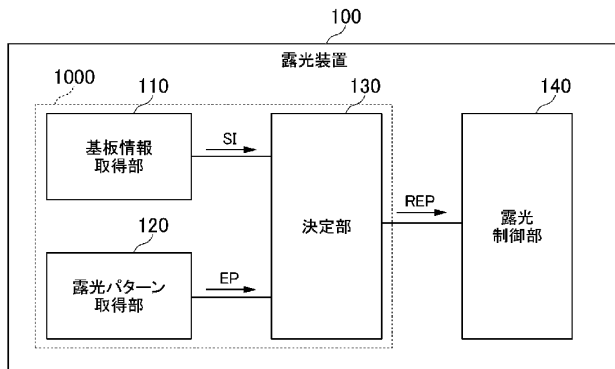
(10) 国際公開番号

WO 2024/162335 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/02 (2006.01) G03F 9/00 (2006.01) 京都港区港南二丁目15番3号 株式会社ニコン内 Tokyo (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2024/002824 (74) 代理人: 西澤 和純, 外(NISHIZAWA Kazuyoshi et al.); 〒1006620 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 Tokyo (JP).
- (22) 国際出願日: 2024年1月30日(30.01.2024)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2023-012405 2023年1月31日(31.01.2023) JP
- (71) 出願人: 株式会社ニコン (NIKON CORPORATION) [JP/JP]; 〒1086290 東京都港区港南二丁目15番3号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 菅谷 功(SUGAYA Isao); 〒1086290 東京都港区港南二丁目15番3号 株式会社ニコン内 Tokyo (JP). 釜下 敦(KAMASHITA Atsushi); 〒1086290 東京都港区港南二丁目15番3号 株式会社ニコン内 Tokyo (JP). 三ッ石 創(MITSUISHI Hajime); 〒1086290 東
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG,

(54) Title: SUBSTRATE PROCESSING SYSTEM, COMPUTATION APPARATUS, EXPOSURE APPARATUS, COMPUTATION METHOD, EXPOSURE METHOD, AND METHOD FOR MANUFACTURING ELECTRONIC DEVICE

(54) 発明の名称: 基板処理システム、演算装置、露光装置、演算方法、露光方法及び電子デバイスの製造方法



- 100 Exposure apparatus
110 Substrate information acquisition unit
120 Exposure pattern acquisition unit
130 Determination unit
140 Exposure control unit

(57) Abstract: This substrate processing system comprises: a substrate information acquisition unit that acquires substrate information including position information pertaining to a structure formed on a first substrate; and a determination unit that determines, on the basis of the acquired substrate information, exposure conditions for exposing a second substrate that is to be bonded to the first substrate.

(57) 要約: 基板処理システムは、第1基板に形成された構造物の位置情報を含む基板情報を取得する基板情報取得部と、取得した前記基板情報に基づき、前記第1基板と接合される第2基板に露光する露光条件を決定する決定部と、を備える。

[続葉有]

ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

- 一 国際調査報告（条約第21条(3)）